

平成 28 年 2 月 吉日

～ 半那純一教授 最終講義のご案内 ～

拝啓

皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本学教授 半那 純一先生におかれましては、平成 28 年 3 月末日をもちまして、定年を迎えられることとなりました。

先生は Si 系薄膜及び液晶性有機薄膜の両者において、イメージングデバイス用の新たな半導体薄膜材料の開発とデバイス応用に関する開発に一貫して取り組まれてこられました。

Si 系薄膜では、反応性熱 CVD 法を開発し、n、p チャネル共に TFT 移動度 $20\text{cm}^2/\text{Vs}$ を超える高品質な Si 多結晶薄膜のガラス基板上での作製へと結実しました。一方、液晶性有機薄膜においては液晶物質における電子伝導を世界ではじめて確立し、ウェットプロセスのみで耐熱性を有し、移動度 $10\text{cm}^2/\text{Vs}$ を超える世界最高レベルの有機トランジスタ材料の開発に成功しました。

これらの成果により応用物理学会フェロー表彰、日本画像学会学会賞、液晶学会学術賞等を受賞されました。

先生のご研究に対する情熱は衰えることなく、今後も活動を続けられるご予定ですが、長年にわたる大学での研究・教育生活のひとつの区切りとして、「最終講義」を行う運びとなりました。

「最終講義」は、下記にご案内の通り、平成 28 年 3 月 11 日（金曜日）17 時より東京工業大学 すすかけ台キャンパスにて、開催致します。また、最終講義終了後には、同キャンパス内にて、簡単ではございますが、半那先生を囲んで懇親会も開催する予定です。

関係者、卒業生の皆様には、年度末のご多忙な候とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ぜひご出席を賜りたく、ここにご案内させていただく次第です。ご出席いただける方につきましては平成 28 年 2 月 29 日（月曜日）までにご出欠についてのお返事を、最終講義案内のホームページ（URL：http://www.isl.titech.ac.jp/~hanna/final_lecture/index.html）にございます、登録フォームよりにて、お知らせ頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

発起人一同

記

日 時 平成 28 年 3 月 11 日（金曜日）17 時開始

会 場 東京工業大学 すすかけ台キャンパス 大学会館 3 階 多目的ホール

*最終講義後に大学会館 3 階 ラウンジにて懇親会を開催する予定です。（会費 5,000 円）

連絡先 国立大学法人東京工業大学 像情報工学研究所 半那・飯野研

住 所： 〒226 - 8503 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259 J1-2

TEL： 045 - 924 - 5181 FAX：045 - 924 - 5181

メール： hanna_final_lecture@isl.titech.ac.jp